

Facteurs de procédé type	Gaz <i>i</i>								
	CF ₄	C ₂ F ₆	CHF ₃	CH ₂ F ₂	C ₃ F ₈	c-C ₄ F ₈	NF ₃ Isolé	NF ₃	SF ₆
Etch 1-U ₁	0,6	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	0,3
Etch P _{CF₄}	S. O.	S. O.	0,07	S. O.	S. O.	0,009	S. O.	S. O.	S. O.
Etch P _{CHF₃}	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,02	S. O.	S. O.	S. O.
Etch P _{C₂F₆}	S. O.	S. O.	0,05	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
CVD 1-U ₁	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,03	0,3	0,9